

УДК 621.383.8; 537.226.82

С. Р. Сырцов

(Витебск, Беларусь)

**РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО МОДУЛЯТОРА СВЕТА
НА ОСНОВЕ СТРУКТУРЫ ПИРОЭЛЕКТРИК — ЖИДКИЙ КРИСТАЛЛ**

Показана возможность использования уравнения теплового баланса для анализа теплового отклика трехслойной структуры пироэлектрик — жидкий кристалл — подложка. Проведен расчет тепловой постоянной времени системы.

В связи с необходимостью создания малогабаритных неохлаждаемых преобразователей изображения, чувствительных к тепловому излучению объектов ($\lambda = 8 - 12 \text{ мкм}$), повышенный интерес вызывают начатые в последние годы исследования по созданию пространственно-временных модуляторов света (ПВМС) на основе структуры пироэлектрик — жидкий кристалл (ПЭ — ЖК) [1—3]. Принципиальная схема такого модулятора представлена на рис. 1. Как было показано ранее [1, 3], эффективность функционирования такой структуры определяется главным образом способностью пироэлектрического слоя генерировать напряжение $U_{\text{ЖК}}$ на ЖК-слое. Последняя, в свою очередь, зависит от теплофизических характеристик структуры и способности пироэлектрика аккумулировать поток энергии $W(t)$ от теплового объекта. Строго говоря, для определения вольт-ваттной чувствительности системы необходимо решить нестационарное уравнение теплопроводности, однако обычно предполагают [1—3], что пироэлектрик равномерно прогрет и расчет прироста температуры слоя θ проводят на основе решения уравнения теплового баланса [4]:

$$\frac{d\theta}{dt} + \frac{\theta}{\tau_t} = W(t), \quad (1)$$

входное изображение

где τ_t — тепловая постоянная времени. При его решении обычно предполагается выполнение условия ($\omega = 2\pi f$, f — частота модуляции излучения)

$$\omega\tau_t \gg 1, \quad (2)$$

которое означает, что оттоком тепла из пироэлектрического слоя можно пренебречь, и, следовательно, строгое решение тепловой задачи не требуется.

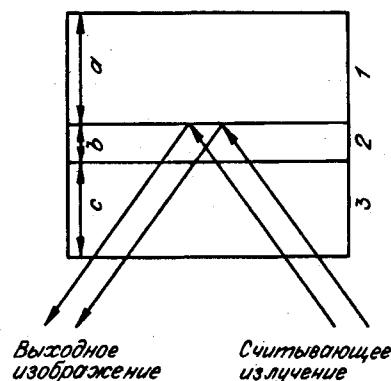


Рис. 1. Принципиальная схема пространственно-временного модулятора света:

1 — пироэлектрический слой, 2 — жидкокристаллический слой, 3 — подложка

Однако возможность использования уравнение теплового баланса (1) и справедливость выполнения неравенства (2) не очевидны и требуют дополнительного обоснования. Рассмотрению этого вопроса и посвящена данная работа.

Рассматриваемая структура представляет собой трехслойную структуру, состоящую из пироэлектрического ($i = 1$), жидкокристаллического ($i = 2$) слоев и подложки ($i = 3$) (см. рис. 1). Со стороны ПЭ структура облучается потоком теплового излучения $W(t)$. При анализе предполагается, что весь тепловой поток поглощается в тонком слое на поверхности пироэлектрика. Предполагается также, что теплоемкостью этого слоя, как и теплоемкостью других технологических слоев на границах ПЭ — ЖК и ЖК-подложка, можно пренебречь по сравнению с теплоемкостью рассматриваемых слоев. Так как поперечные размеры структуры существенно больше суммарной толщины составляющих ее слоев, можно ограничиться решением одномерного нестационарного уравнения теплопроводности

$$\frac{\partial \theta_i}{\partial t} = \frac{K_i}{C_i} \frac{\partial^2 \theta_i(x, t)}{\partial x^2} \quad (3)$$

с граничным условием $J(0) \equiv -K_1 \frac{\partial \theta_1(x)}{\partial x} \Big|_{x=0} = \eta W(t) - g_h \theta_1(0)$, где K_i и C_i — коэффициент теплопроводности и теплоемкость соответствующего слоя; $g_h = 4\sigma T_0^3 \eta$ (σ — постоянная Стефана — Больцмана); $\theta_1(0)$ — прирост температуры на поверхности ПЭ; η — поглощающая способность.

Интегрируя (3) по толщине пироэлектрического слоя, можно получить уравнение для определения средней величины прироста температуры пироэлектрика $\bar{\theta}_1(t) \equiv \frac{1}{a} \int_0^a \theta_1(x, t) dx$ ($\theta_1 = T - T_0$, T_0 — температура окружающей среды):

$$\frac{\partial \bar{\theta}_1(t)}{\partial t} + \frac{J(a, t)}{c_i a} = \frac{W(t) - g_h \theta_1(0)}{c_i a}, \quad (4)$$

где $J(a, t)$ — поток тепла из пироэлектрического слоя в структуру.

Для определения величин $J(a, t)$ необходимо решить уравнение теплопроводности (3) для трехслойной структуры. В случае используемого на практике модулированного потока по закону $W(t) = W_0(1 + e^{i\omega t})$ решение (3) удобно искать [5] в виде $\theta_i(x, t) = \theta_i(x)e^{i\omega t}$. С учетом граничных условий и равенства температур и тепловых потоков на границах раздела слоев после несложных, но громоздких преобразований находим:

$$\theta_1(0) = P \bar{\theta}_1, \quad (5)$$

$$J(a) = K_1 \frac{a(P - \operatorname{ch}(a/L_1))}{L_1^2(\operatorname{ch}(a/L_1) - 1)(1 + P)} \bar{\theta}_1, \quad (6)$$

при этом параметр P определяется выражением

$$P = \operatorname{ch}(a/L_1) + \frac{K_2 L_1}{K_1 L_2} \frac{\operatorname{sh}(a/L_1)}{\operatorname{sh}(b/L_2)} \left\{ \operatorname{ch}(b/L_2) - \frac{1}{\operatorname{ch}(b/L_2) + \frac{K_3 L_2}{K_2 L_3} \operatorname{sh}(b/L_2) \operatorname{th}(c/L_3)} \right\}^{-1}, \quad (7)$$

$L_i = \frac{1-i}{2} \lambda_{ni}$; $\lambda_{ni} = \sqrt{\frac{K_i}{\omega C_i}}$ — длина температурной волны в среде; c_{vi} — удельная объемная теплоемкость i -го слоя.

Заметим, что согласно (5) поток тепла из пироэлектрического слоя пропорционален средней величине прироста температуры пироэлектрического слоя $\bar{\theta}_1$. Это обстоятельство позволяет привести уравнение (4) к стандартно-

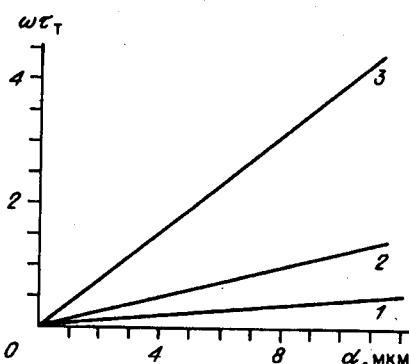


Рис. 2. Зависимость величины $\omega\tau_t$ от толщины пироэлектрического слоя:
 $f = 10$ Гц, $I = b = 2, 2 - 10, 3 - 50$ мкм

му виду уравнения баланса (1) для величины $\bar{\theta}_1$. При этом тепловая постоянная времени системы τ_t определяется выражением

$$\tau_t = \frac{c_1 L_1^2 (\text{ch}(a/L_1) - 1)(1 + P)}{K_1(P - \text{ch}(a/L_1))} \quad (8)$$

и зависит теперь от частоты модуляции и параметров всех составляющих структуру слоев.

Полученные выше выражения позволяют использовать для оценки чувствительности системы известные соотношения теории пироэлектрических приемников излучения [4] и оценить влияние на ее величину частоты модуляции и параметров структуры.

Анализ показывает, что тепловая постоянная времени τ_t слабо зависит от величины теплоемкости слоев и коэффициентов теплопроводности, а определяется главным образом толщиной пироэлектрического и жидкокристаллических слоев. До тех пор, пока длина тепловой волны в пироэлектрическом слое превышает ее толщину, зависимость τ_t от f следует закону $\sim 1/f$. При $\lambda_{t1} \sim a$ наблюдается отклонение от этого закона, и при высоких частотах ($\lambda_{t1} < a$) $\tau_t \sim \frac{1}{\omega} \exp\left(\sqrt{\frac{w c_1}{K_1}} a\right)$. На рис. 2 представлена зависимость величины $\omega\tau_t$ от толщин, составляющих структуру слоев. Видно, что обычно постулируемое неравенство (2), выполнение которого позволяет пренебречь оттоком тепла из пироэлектрического слоя и упростить расчет характеристик системы, при обычных толщинах ЖК-слоя (~ 10 мкм) выполняется лишь для $a \geq 10$ мкм. Уменьшение толщины пироэлектрического слоя с целью повышения чувствительности системы может привести к нарушению этого условия и к необходимости учета влияния на величину τ_t параметров других слоев структуры. Это обстоятельство особенно важно учитывать при создании ПВМС по тонкопленочной технологии. Отметим также, что приведенные в работе выражения остаются верными и при учете различных добавочных технологических слоев (чернильного покрытия, диэлектрического зеркала и т. д.). Их учет приводит лишь к перенормировке параметра P .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ватурин В. П., Дергачев Д. Н., Компанец И. Н. и др. Пространственно-временной модулятор света на основе структуры «пироэлектрик — жидкий кристалл». — М., 1985. — (Препр. ФИАН; 248).
2. Kalman P., Toth A. Pyrooptic converter based on a combination of pyroelectric and electrooptic effects // Ferroelectrics. — 1987. — 75. — P. 173.
3. Дубровская Т. С., Михневич В. В., Потапенко И. П., Сырцов С. Р. Сенситометрические характеристики модулятора света на основе структуры пироэлектрик — жидкий кристалл // Автометрия. — 1991. — № 4.
4. Косоротов В. Ф., Кременчугский Л. С., Самойлов В. Б., Щедрин Л. В. Пироэлектрический эффект и его практические применения. — Киев: Наук. думка, 1989.
5. Van der Ziel A. Pyroelectric response and D^* of thin pyroelectric films on a substrate // J. Appl. Phys. — 1973. — 44, N 2. — P. 546.

Поступила в редакцию 19 октября 1992 г.